Ta 99.99高纯钛棒 PVD磁控溅射镀膜 可定制

产品名称	Ta 99.99高纯钛棒 PVD磁控溅射镀膜 可定制
公司名称	长沙鑫康新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	元素符号:Ta 纯度:3N5, 4N 形状:平面靶 旋转靶 异型定制
公司地址	湖南省长沙县榔梨街道新建路1301001
联系电话	19118893713 19118893713

产品详情

钽靶材，钽化学符号Ta，钢灰色金属，在元素周期表中属VB族，原子序数73，原子量180.9479，体心立方晶体，常见化合价为+5。钽的硬度较低，并与含氧量相关，普通纯钽，退火态的维氏硬度仅有140HV。它的熔点高达2995℃，在单质中，仅次于碳，钨，铼和锇，位居第五。钽富有延展性，可以拉成细丝式制薄箔。其热膨胀系数很小。每升高一摄氏度只膨胀百万分之六点六。除此之外，它的韧性很强，比铜还要优异。高纯钽可用作容量大、体积小、性能稳定的固体电解电容，用于雷达、导弹、超音速飞机和电子计算机上、钽还能制造石油化工热交换器、加热器、浓缩器及反应器的槽、塔、管道和阀门等。钽也可以用作电子发射管和高功率电子管零件材料，钽合金可做超音速飞机燃烧室和耐热耐高强材料，钽钨合金的导弹喷嘴，碳化钽可单独或与其他碳化合物一起，用作锻模、切削工具、喷气发动机涡轮叶片、阀及火箭喷嘴涂层。碳化钽广泛用于制造硬质合金。钽还具有与人体组织的稳定性和愈合性，可用作外科补形材料和人造骨头，还可用作接骨板、螺丝和

缝合针等。下图是钽溅射靶材的显微金相检测图片，平均粒径<100um。

??

我们生产高纯度的溅射靶材，重要的好处是在物理气相沉积的过程中，能获得具有优异的导电率和颗粒细小化的薄膜。以下表格是3N5高纯钽溅射靶的成分分析证明书。采用的分析方法：1，使用ICP-OES对金属元素进行分析；2，使用LECO进行气体元素分析。